

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 2 日 (02.06.2005)

PCT

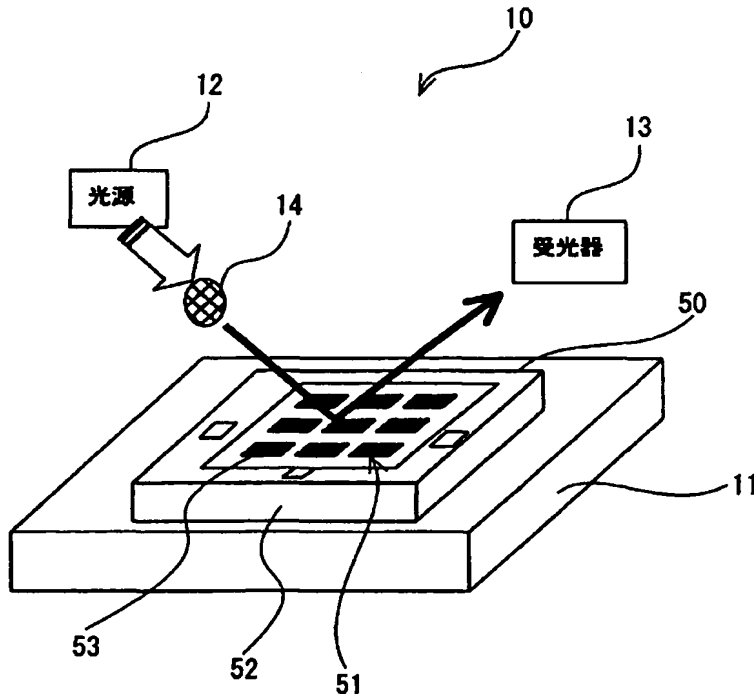
(10) 国際公開番号
WO 2005/050132 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01B 11/30 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017078 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中 淳一
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 17 日 (17.11.2004) (TANAKA, Junichi) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 HOYA 株式会社内
(25) 国際出願の言語: 日本語 Tokyo (JP). 山口 昇 (YAMAGUCHI, Noboru) [JP/JP];
(26) 国際公開の言語: 日本語 〒1618525 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号
(30) 優先権データ: 特願 2003-390821 HOYA 株式会社内 Tokyo (JP).
2003 年 11 月 20 日 (20.11.2003) JP (74) 代理人: 阿仁屋節雄, 外 (ANIYA, Setuo et al.); 〒
1020072 東京都千代田区飯田橋 4 丁目 6 番 1 号
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): HOYA 株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 Tokyo (JP). (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

[続葉有]

(54) Title: METHOD OF INSPECTING UNEVENNESS DEFECT OF PATTERN AND DEVICE THEREFOR

(54) 発明の名称: パターンのムラ欠陥検査方法及び装置



12... LIGHT SOURCE
13... LIGHT RECEIVING UNIT

受光部 13 とを有し、この受光データを観察して上記繰り返しパターンに発生したムラ欠陥を検出するムラ欠陥検査装置 10 において、複数の波長帯の光が

(57) Abstract: A plurality of kinds of unevenness defects produced in patterns formed on the surface of an object of detection can be detected with high accuracy. An unevenness defect inspecting device (10) which comprises a light source (12) for applying a light to a photomask (50) provided on the surface thereof with a repeating pattern (51) consisting of unit patterns (53) arranged regularly, and a light receiving unit (13) for receiving a scattered light from the photomask for conversion into light reception data, and which observes the light reception data to detect unevenness defects produced in the repeating pattern, characterized in that the device further comprises a wavelength filter (14) for selecting one or a plurality of lights in desired wavelength bands from lights in a plurality of wavelength bands and extracting them, and the lights in the selected and extracted bands are used to detect unevenness defects in the repeating pattern.

(57) 要約: 被検査体の表面に形成されたパターンに発生する複数種類のムラ欠陥を高精度に検出できること。単位パターン 53 が規則的に配列されてなる繰り返しパターン 51 を表面に備えたフォトマスク 50 に光を照射する光源 12 と、上記フォトマスクからの散乱光を受光して受光データに変換する

[続葉有]



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。